

глощания связано с тем, что сечение фотопионизации σ_1 гораздо больше всех других сечений в задаче, и поэтому с ростом интенсивности излучения увеличивается число ионизированных доноров, что и приводит к уменьшению интегрального поглощения.

Рассмотренная выше ситуация экспериментально была осуществлена в работе [3]. На рисунке приведены зависимость $\bar{\alpha}(I_0)$, рассчитанная на основе уравнений (1), (2) с параметром $\varepsilon_4 \langle v \rangle = 5.2 \cdot 10^{-8} \text{ см}^3/\text{с}$, согласующимся с известными данными [4], и результаты эксперимента [3]. При нахождении $\bar{\alpha}(I_0)$ нами было рассчитано сечение двухфотонного поглощения в условиях эксперимента [3], которое оказалось равным $\sigma_{\text{двух}} = 1.4 \cdot 10^{-18} \text{ см}^4/\text{МВт}$.

Как видно из рисунка, во всей исследованной области до 10 МВт/см² имеет место согласие теории с экспериментом.

Следует указать, что в [3] также рассчитан средний коэффициент поглощения $\bar{\alpha}(I_0)$, который, однако, в области больших интенсивностей расходится с экспериментом. На наш взгляд, это расхождение может быть связано с пре-небрежением в [3] двухфотонными непрямыми переходами $L \rightarrow G$. В работе [3] отклонение рассчитанной кривой от эксперимента объясняется тем, что наряду с прямым захватом не учтен переход электрона из зоны на основной примесный уровень через возбужденные донорные состояния. Хотя отмеченный процесс в принципе может влиять на интегральное поглощение, к сожалению, в [3] не рассчитан вклад данного механизма. Дополнительные измерения электропроводности *n*-Ge при облучении CO₂-лазером могли бы выявить роль отмеченных механизмов нелинейности в интегральном поглощении.

Список литературы

- [1] Смит Р. Полупроводники. М., 1982. 558 с.
- [2] Аветисян С. К., Минасян Г. Р. // ФТТ. 1989. Т. 31. В. 5. С. 87—90.
- [3] McManus J. B., People R., Aggarwal R. L., Wolff P. A. // J. Appl. Phys. 1981. V. 52. N 7. P. 4748—4752.
- [4] Ascarelli G., Brown S. C. // Phys. Rev. 1960. V. 120. N 5. P. 1615—1626.

Ереванский политехнический институт
им. К. Маркаса

Получено 31.07.1989
Принято к печати 1.12.1989

ФТП, том 24, вып. 4, 1990

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ДЫРОК В АМОРФНОМ ГИДРИРОВАННОМ КРЕМНИИ МЕТОДОМ ВИДИКОНА

Голикова О. А., Заец А. И., Казанин М. М., Петров И. Н.

Данных о переносе дырок в аморфном гидрированном кремнии (*a*-Si : H) значительно меньше, чем о переносе электронов — $(\mu\tau)_n \gg (\mu\tau)_p$, и поэтому из обычных экспериментов по фото- и темновой проводимости и из вольтамперных характеристик (ВАХ) нелегированного (*i*) *a*-Si : H получают информацию лишь о переносе электронов (μ , τ — подвижность и время жизни носителей тока). В настоящей работе перенос дырок в *a*-Si : H был исследован методом видикона [1]. При этом ставилась задача получения информации об энергетическом распределении и величинах плотности локализованных состояний ($g(\epsilon)$) в области щели подвижности ниже равновесного уровня Ферми. Далее определялось соответствие этой информации данным о $g(\epsilon)$ и о величинах параметров дрейфа ($\mu\tau)_p$, полученных на аналогичных образцах *i*-*a*-Si : H из других экспериментов.

Исследовались мишени видикона, способ изготовления, спектральная и люксамперная характеристики которых описаны в [2]. Структура мишней

представляла собой последовательно нанесенные на стеклянную подложку ($\phi = 25$ мм) слоя ИТО $n^+ - a\text{-Si} : \text{H}$ (0.1 мкм), $i - a\text{-Si} : \text{H}$ (1.5 ± 2 мкм), Sb_2S_3 (0.1 мкм). Освещение производилось со стороны подложки, считывание электронным лучом — со стороны Sb_2S_3 . Положительное смещение (V) прикладывалось к ИТО. Параметры аналогичных, полученных при одинаковых условиях напыления образцов $i - a\text{-Si} : \text{H}$ следующие [3]: оптическая ширина запрещенной зоны $E_g = 1.6$ эВ, энергия активации темновой проводимости (σ_0) $\Delta E =$

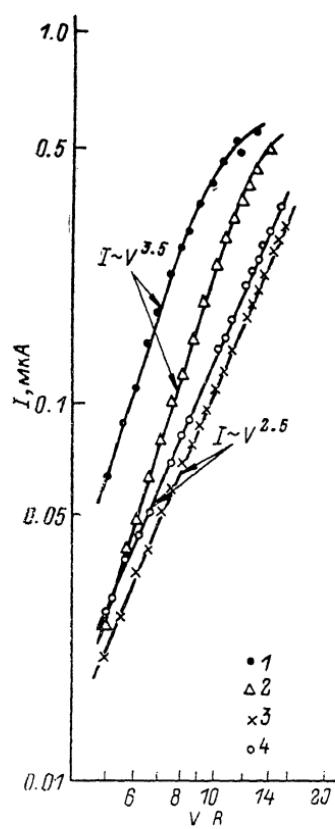


Рис. 1. ВАХ мишней (дырочный ток).

Освещенность ($\lambda = 0.417$ мкм), лк: 1 — 3.15; 2—4 — 1.8.

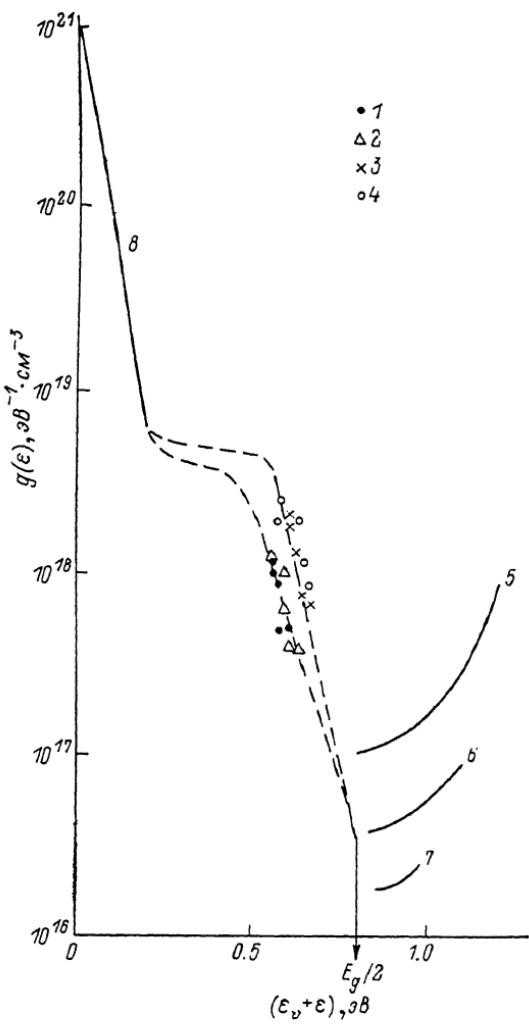


Рис. 2. Плотность состояний в зависимости от энергии.

Расчеты по данным ВАХ $a\text{-Si} : \text{H}$, определяемых механизмом ТОПЗ. 1—4 — данные настоящей работы; обозначения те же, что на рис. 1; 5—7 — $g(\epsilon)$, определенные из ВАХ $n^+ - i - n^+$ -структур (электронный ТОПЗ) [4, 6]; 8 — хвост n^- -зоны по данным времязпролетной методики [1]; штрихи — экстраполяции.

$= 0.7 \pm 0.8$ эВ, фотопроводимость $\sigma_\phi \approx 10^{-6} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ ($\Phi = 10^{15} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$, $\lambda = 0.625$ мкм, $T = 300$ К), отношение $\sigma_\phi / \sigma_0 \approx 10^3$ ($T = 300$ К), величина плотности локализованных состояний на уровне Ферми $10^{16} \pm 10^{17} \text{ эВ}^{-1} \cdot \text{см}^{-3}$, параметр $(\mu \tau)_p$, измеренный по времязпролетной методике,¹ $10^{-9} \pm 10^{-10} \text{ см}^2/\text{В}$.

При наиболее коротковолновом освещении ($\lambda = 0.417$ мкм [2]) свет поглощается в приповерхностной области i -слоя и лишь дырки проходят через всю его толщину (L). Таким образом, метод видикона дает возможность непосредственно наблюдать перенос дырок.

¹ Измерения проведены в ВГУ (Вильнюс).

Вольтамперные характеристики (ВАХ) мишней (рис. 1) включают в себя области, определяемые механизмом токов, ограниченных пространственным зарядом (ТОПЗ), в пределе $[(\mu\tau)_p E \geq L]$ переходящие в область насыщения [1].

В области ТОПЗ

$$I \sim V^n, \quad (1)$$

где $n=1+T_c/T$. Если плотность состояний вблизи квазиуровня Ферми представить как $g(\epsilon) \sim \exp(-\epsilon/kT_c)$, то из экспериментальных ВАХ можно определить T_c .

Однако, используя метод, предложенный в [4], можно определить среднюю величину \bar{g} в интервале энергий $\epsilon_{F_2} - \epsilon_{F_1}$ (ϵ_{F_2} и ϵ_{F_1} — квазиуровни Ферми при приложении к мишени напряжений V_2 и V_1 соответственно):

$$\bar{g} = \frac{2\epsilon_s(V_2 - V_1)}{eL^2kT \ln(I_2V_1/I_1V_2)}, \quad (2)$$

где ϵ_s — диэлектрическая проницаемость; I_2 , I_1 — соответствующие токи.

При этом

$$\epsilon_{F_2} - \epsilon_{F_1} = kT \ln(I_2V_1/I_1V_2) \quad (3)$$

и, если эти разности достаточно малы, можно «шаг за шагом» построить $g(\epsilon)$. Начальное (при минимальном напряжении на мишени) положение квазиуровня Ферми определяется из следующего выражения:

$$j = e\mu_v V / LN_v \exp(-\epsilon_F/kT), \quad (4)$$

где j — плотность тока, N_v — эффективное число состояний v -зоны, μ_v — подвижность дырок ($N_v \mu_v \approx 10^{21} \text{ см}^{-1} \cdot \text{В}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$ [4]).

Метод [4] в настоящей работе применен к анализу ВАХ мишней видикона из $a\text{-Si : H}$ впервые. Поскольку в данном случае на положение квазиуровня Ферми влияют как освещенность, так и сильное электрическое поле, зондируется область щели подвижности $a\text{-Si : H}$, расположенная существенно ниже равновесного уровня Ферми, что не удается с помощью методов, применяемых нами ранее [3].

ВАХ мишней 1 и 2 обнаруживают тенденцию к насыщению при $V \geq 10$ В, поэтому можно оценить $(\mu\tau)_p \leq 10^{-9} \text{ см}^2/\text{В}$. Для мишней 3 и 4 значения $(\mu\tau)_p$, очевидно, более низкие. Наклоны ВАХ в области ТОПЗ у мишней 1, 2 и 3, 4 также различаются (рис. 1): T_c , определенные по формуле (1), равны 750 и 450 К.

На рис. 2 представлены результаты определения $g(\epsilon)$ на основе данных рис. 1 с использованием формул (2)–(4) и учетом того, что площадь сканирования мишени электронным лучом равна 1.2 см^2 . Величины плотности состояний, определенные из данных для мишней 1 и 2, несколько ниже, чем для 3 и 4, что согласуется с оценками $(\mu\tau)_p$. Отметим также, что измеренные по времязаделенной методике $(\mu\tau)_p$ для аналогичных образцов по порядку величин согласуются с $(\mu\tau)_p$, оцененными в настоящей работе.

Экстраполяция кривых рис. 2 к середине щели подвижности (местоположение равновесного уровня Ферми) дает величины плотности состояний $10^{16} \div 10^{17} \text{ эВ}^{-1} \cdot \text{см}^{-3}$, совпадающие с приведенными выше для аналогичных образцов. Основанием для экстраполяции в сторону «хвоста» v -зоны служат полученные ранее методом ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии данные о форме кривой $g(\epsilon)$ в области щели подвижности $a\text{-Si : H}$ ниже равновесного уровня Ферми [4]: для образцов с указанной выше фоточувствительностью на кривой $g(\epsilon)$ наблюдаются перегибы или плато. На рис. 2 для сопоставления приведены также литературные данные о $g(\epsilon)$ $a\text{-Si : H}$, полученные методом ТОПЗ, но путем исследований электронного переноса в $n^+ - i - n^+$ -структурах [5, 6].

Список литературы

- [1] Ода Ш., Томита Х., Шимизу И. // Аморфные полупроводники / Под ред. И. Хамагава. М., 1986. С. 132—143.
- [2] Голикова О. А., Казанин М. М., Мездрогина М. М., Петров И. Н., Сорокина К. Л. // Письма ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 4. С. 85—87.
- [3] Голикова О. А., Казанин М. М., Кудоярова В. Х., Сорокина К. Л., Бабаходжаев У. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 10. С. 1737—1740.
- [4] Терехов В. А., Голикова О. А., Домашевская Э. П., Тростянский С. Н., Мездрогина М. М., Сорокина К. Л. // ФТП. 1984. Т. 18. В. 10. С. 1897—1899.
- [5] Den Boer W. // J. de Phys. 1981. V. 42. P. C4-451—C4-454.
- [6] Спир У., Ле-Комбер П. // Физика гидрогенизированного аморфного кремния / Под ред. Дж. Джоунопулоса, Дж. Люковски. М., 1987. С. 85—155.

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
АН СССР
Ленинград

Получено 22.11.1989
Принято к печати 1.12.1989